

昆山光刻版

产品名称	昆山光刻版
公司名称	苏州微麦光电有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	苏州工业园区星湖街328号崇文路国华大厦B418室
联系电话	17710798515

产品详情

光刻板业内又称光掩模版、掩膜版，光刻版，光罩，英文名称 MASK 或 PHOTOMASK），材质：石英玻璃、金属铬和感光胶，该产品是由石英玻璃或者苏打玻璃作为衬底，在其上面镀上一层金属铬和感光胶。（感光胶又称光致抗蚀剂，是利用光化学反应进行图形转移的媒体性精细化学品，根据不同的用途性能等有多种型号，目前光掩模版大多数都是用的正性胶。光刻正性胶在经激光照射后，曝光区的邻重氮萘醌化合物发生光解反应重排成羧酸，使胶膜加速溶于稀碱水溶液。）把已设计好的电路图形通过电子激光设备曝光在感光胶上，被曝光的区域会被显影出来，在金属铬上形成电路图形，成为类似曝光后的底片的光掩模版，然后应用于对集成电路进行投影定位，通过集成电路光刻机对所投影的电路进行光蚀刻，其生产加工工序为：曝光，显影，去感光胶，最后应用于光蚀刻。

公司产品包括石英掩膜版，苏打掩膜版，以及菲林版。苏州制版根据客户的构想、草图，定制版图，苏州制版提供高质量掩膜版以及后期的代加工服务！

刻蚀或离子注入完成后，将进行光刻的最后一步，即将光刻胶去除，以方便进行半导体器件制造的其他步骤。通常，半导体器件制造整个过程中，会进行很多次光刻流程。生产复杂集成电路的工艺过程中可能需要进行多达50步光刻，而生产薄膜所需的光刻次数会少一些。

掩膜版：通俗点理解，相当于过去用胶片冲洗照片时的底片。底片如果精度不够，是洗不出来高精度照片的。光刻机施工前，要根据设计好的芯片电路图制作掩膜板。掩膜板材质是石英玻璃，玻璃上有金属铬和感光胶。通过激光在金属铬上绘制电路图。精度要求非常高。

透镜：用透镜的光学原理，将掩膜版上的电路图按比例缩小，再用光源映射的硅片上。光在多次投射中会产生光学误差。要控制这个误差。精度要求很高。

就是测量台移动的控制器，也是纳米级精度，要求超高。

昆山光刻版由苏州微麦光电有限公司提供。昆山光刻版是苏州微麦光电有限公司（www.szphotomask.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：叶佳

。